

# (2026年3月卒業者向け) ギガフoton株式会社 インターンシップ概要

イ ン タ ー ン シ ッ プ 情 報	対象	1、大学または大学院で理工・物理系を学ぶ学生 専門性を要するプログラムのため、各テーマで大学・大学院で専攻されている分野を特定します。 2、5日間のプログラム全日程参加可能な学生 全日程を通じて連続したプログラムを準備していますので、学業・研究の都合も含めて参加可能な方のみ応募を受け付けています。		
	開催期間 定員	・2024年8月5日(月) ~ 9日(金) 最大2名 ・2024年8月26日(月) ~ 30日(金) 最大2名 ・2024年9月2日(月) ~ 6日(金) 最大2名 ・2024年9月9日(月) ~ 13日(金) 最大2名		
	申込期間	2024年6月1日(日) ~ 各日程の2週間前まで、エントリーを受付けます。		
	IS受入職種 ISテーマ	【研究開発職】 ① エキシマレーザのチャンバ寿命についての検討 ② 次世代KrFレーザ用狭帯域化モジュールの性能評価 ③ 次世代エキシマレーザ用光学モジュールの設計 ④ 次世代エキシマレーザの波長制御/スペクトル制御の検討 ⑤ ビームダイバージェンス計測器モジュールの評価 ⑥ 次世代高繰返しエキシマレーザに向けたレーザ性能評価 ⑦ エキシマレーザ制御システムの分析および評価 ⑧ エキシマレーザ用光学モジュールの機械設計 ⑨ エキシマレーザ制御用次世代コントローラの性能評価 ⑩ カーボンニュートラルに向けた次世代エキシマレーザ用の超高回転ガスフロー技術 ⑪ 露光シミュレーションによる次世代エキシマレーザ用の光学応用技術 ⑫ 微細加工用深紫外レーザの高出力・高コヒーレンス化のための波長変換技術 ⑬ 深紫外ArFエキシマレーザを用いた難加工材料の微細加工技術 ⑭ シミュレータを用いたEUV光源用ソフトウェアシーケンスの動作確認 ⑮ 高周波振動付与時の液体スズ柱から液滴化する過程の計測と解析 ⑯ EUV光源チャンバ内の水素ガス流れによるスズ原子分布の計算 ⑰ 半導体加工用エキシマレーザの性能計測、分析 ⑱ 半導体加工用エキシマレーザの自動運転プログラム作成 ⑲ 半導体実装材料へのレーザ照射シミュレーション ⑳ 半導体実装材料へのエキシマレーザ微細加工性調査		
	開催場所	ギガフoton小山本社 8:00~16:45 (栃木県小山市横倉新田400)	必要書類	インターンシップエントリーシート (Web回答)
	報酬・交通費	交通費+食費相当分を支給 ※遠方から参加いただく方には、 規定に基づき宿泊先を当社で手配します。	IS保険	ギガフotonにて付保 ※参加者側(学校または個人)にも 別途加入いただきます。
	応募について	① 右記URLよりエントリー ▼ ② 日程とテーマを選択 ▼ ③ WEBテストによる学力・適性試験 / IS用エントリーシート提出 ▼ ④ IS参加		

26ギガフotonISEントリーはこちら

